PAT-NO:

JP403250635A

DOCUMENT -

JP 03250635 A

IDENTIFIER:

TITLE:

MANUFACTURE OF SEMICONDUCTOR DEVICE AND MOLDING

**DEVICE** 

PUBN-DATE:

November 8, 1991

# INVENTOR-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

KASUGA, TAKAHIRO

## ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

HITACHI LTD

N/A

HITACHI HOKKAI SEMICONDUCTOR LTD N/A

**APPL-NO:** JP02045450

APPL-DATE: February 28, 1990

INT-CL (IPC): H01L021/56

US-CL-CURRENT: 264/272.17

#### ABSTRACT:

PURPOSE: To inhibit the generation of void in a package by forming a resin intake passage to each gate which communicates with each cavity which comprises a groove formed on the surface of a lower mold and an upper mold.

CONSTITUTION: After a lead frame mounted with semiconductor chips is set into lower molds of grooves 4, 4' comprising each cavity, both lower and upper molds are brought into a mold-fastened state based on the application of pressure, such as hydraulic pressure. Under this state, resin 13 formed in tablet shape is cast into a pot 11, heated and molten. When a plunger 14 is lowered along the inner wall of the pot 11 and the resin 13 is compressed, the molten resin 13 flows into

gates 3 along the surface of a side 2A of cull. At that time, most of the air involved in the resin flows along the side of gates 3, but the resin flowing ahead easily involving the air and the resin near the side of the gate, flow into a resin intake passage 12, and the resin flowing in the central part where no air is involved, is injected into cavities 4.

COPYRIGHT: (C) 1991, JPO&Japio

#### ⑫ 公 開 特 許 公 報(A) 平3-250635

@int.Cl.5 H 01 L 21/56

庁内整理番号 識別配号

❸公開 平成3年(1991)11月8日

T 6412-5F

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全5頁)

半導体装置の製造方法およびモールド装置 60発明の名称

> 願 平2-45450 20特

22出 願 平2(1990)2月28日

北海道亀田郡七飯町字中島145番地 日立北海セミコンダ @発 明 者 В 孝 弘 春

クタ株式会社内

東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地 の出 願 人 株式会社日立製作所

北海道亀田郡七飯町字中島145番地 日立北海セミコンダク 勿出 願人

タ株式会社

70代理人 弁理士 小川 勝男 外1名

#### 明

1. 発明の名称

半導体装置の製造方法およびモールド装置

- 2. 特許請求の範囲
  - 1.リードフレームに直接または絶縁基板等を介 して間接的に半導体チップを取り付け、かつ上 記半導体チップ上の電極とリードフレームの所 望部とを電気的に接続する組立工程と、上記り ードフレームを下型および上型からなるモール ド型に型締めした後、前記下型あるいは上型の 表面に形成された複数本のゲートを介して溶験 したシジンを上記両型面に形成した溝によって 構成されるキャビティ内に圧入して上記リード フレームの所定部分をレジンにて覆うモールド 工程とを有する半導体装置の製造方法であって、 上記ゲートに連通したレジン引込路に流動する レジンの先端部を引き込み、封止を行なうこと を特徴とする半導体装置の製造方法。
  - 2.上型または下型に形成されたタブレット状に 成型されたレジンを投入するための複数のポッ

- トと、上記ポットに沿って移動しポット内に投 入したタブレット状のレジンを圧縮するための プランジャと、上記両型面の片方に形成され、 かつ上記ポットを挟んで両側の位置に形成され たゲートと、各ゲートにそれぞれ対応して配置 され、両型面にて形成されているキャピティと 隣接するゲートに達通して設けられたレジン引 込路が形成されていることを特徴とするモール ド 乾 響。
- 3. 上型または下型に形成されたタブレットを投 入するための複数のポットを一列に配置してい ると共に、各ポットに対して両側に上型または 下型に形成しているゲートと、各ゲートにそれ ぞれ対応して配置され、両型面に形成した溝で 構成されているキャビティと各ゲートと連結し て設けられたレジン引込路を有し、かつ上記レ ジン引込路は複数本のゲートに共通して形成さ れていることを特徴とするモールド装置。
- 3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は半導体装置の製造技術、特にトランス ファモールドによってパッケージを製造する半導 体装置に関するものである。

#### 〔従来の技術〕

半導体チップを取り付けワイヤボンディングが 完了したリードフレームをセットしたのち、モールド金型の上型と下型との間に挟んで型締めが、 投、上型のほぼ中央部に設けたポット内にタレット型に成形した粉末樹脂を投入する。そしてプランジャをポットの内壁面にそって下降させておけたレジンを上下型によって形成されたランスではよびゲートを介してキャビティ内に位置するリードフレーム部分をレジンで覆うようにしている。

ところが、上述のようなモールド装置にあつては、長いランナーがあるためレジンの使用効率が極めて悪く、また電子材料別冊1987年版超LSI製造・試験装置ガイドブック工業調査会発行p160~165等に記載されているように自動化が可能なマルチプランジャモールド金型が採用

第7図にて示すⅣ~Ⅳ線及びV~V線に、レジン6の断面を観測すると、第8図及び第9図にて分かるように連結部5だけでなく、キャビティ4,4個のレジンにも空気(ポイド)7が巻き込まれており、ポイドの原因となることが多々あり、今後ますます軽薄短小化の進む半導体装置にあっては、よりポイドの発生を低減させる必要があった。

本発明の目的は、パッケージ内のポイド発生を抑制できるモールド技術を提供するものである。

本発明の他の目的は、マルチプランジャ型のモールド装置におけるモールド製品の品質向上を達成するものである。

#### [課題を解決するための手段]

本顧において関示される発明のうち代表的なも のの概要を簡単に説明すれば、下記のとおりであ る。

すなわち上下型表面に形成した溝で構成される 各キャビティに連通する各々ゲートにレジン引込 路を形成するものである。

#### [作用]

されるようになってきた。マルチプランジャは長 いランナーがなく直接ゲートを介して 2 ~ 4 個の キャピティ内にレジンを注入するように成ってい ス

第6図は上述のマルチプランジャモールド金型の下型平面図、第7図はレジン注入時の状態説明図、第8図及び第9図はそれぞれⅣ-Ⅳ線及びV-V線断面図である。

1は下型であり、その表面にはタブレット状に成形したレジン(図示せず)を載せるカル(上型に設けたポットに対応している)が形成され、このカル2を挟んでゲート3、3が設けられている。

4,4は半導体装置のパッケージを形作るキャビティとなる溝であり各ゲート3,3は上記溝に 速通して形成されている。

5 は各カル間を連結する連結部であり、カル 2 に置いたタブレット状レジンを溶融した状態でゲート 3 、 3 を介してキャビティ 4 、 4 内に圧入する際の空気の抜け道として形成されている。

[発明が解決しようとする課題]

上記した手段によれば、キャビティ内にレジンが流入する直前で、空気を巻き込んでいる流動レジン先端部及び側面部をレジン引込路内に引込み、キャビティへは空気を巻き込んでいないレジンを 注入することができ、ボイドのないパッケージが 得られるものである。

### (寒族例)

第1回は、本発明の一実施例であるモールド装置の下型平面図、第2回は第1回のモールド装置部分拡大図、第3回及び第4回はそれぞれ第2回の1-1線およびⅡ-Ⅱ線断面図、第5回は、第1回のモールド装置をⅢ-Ⅲ線で切断した際の断面構成図である。

以下、図に従い詳細に説明する。なお、第6回にて説明した構成と同一構成部分については同符号を付し、その節名を省略する。

図示するように下型10の表面にはポット11 に対抗してカル2,2が複数直列に配置されている。また、上記カル2,2を挟んで両側にはカル 2,2の配列方向と直行する方向にゲート3,3 が一対形成されており、かつ各々ゲート3,3に は半導体装置(図示せず)のキャビティを構成す る薄4,4が形成されている。12,12のゲート3,3に連通するレジン引込路で、本実施例で はカル2,2に対して同方向側に位置するゲート 3,3に共通して形成されている。

 空気が巻き込まれ易いレジン流動先端部及びゲート側面近傍を流れるレジンはレジン引込路 1 2 に流れていき、空気の巻き込んでいないゲート中央部を流れるレジンがキャビティ 4 、 4 に注入されていくことになる。従って、第 4 図で示すようにレジン引込路 1 2 にはレジン内に空気 1 5 が巻き込まれているが、キャビティ 4 に注入されたレジンには空気が存在していない。従って、ボイドのない半導体装置が得えられることになる。

次に本実施例の作用及び効果について説明する。
(1) 各ゲートにレジン引込路を形成することにより、カル壁面のどの領域で巻き込んだ空気であっても、かならずゲートの側面に沿って流れていくためレジン引込路へと引込まれていき、空気の巻き込んでいない、すなわちゲートの中央部分を流れるレジンがキャビティ内へと充填されていく。そのためボイドのない耐湿性良好な半導体が得られるものである。

(2) 上記により、モールドにおける品質歩留を飛 躍的に向上させることができるという効果が得ら

れる.

(3) 同方向に延在するゲートに対して共通したレジン引込路を設けることにより、より簡単に型を製作できると共にモールド完了後不要となったレジンを型から取り出す際に各ゲートに共通したレジン引込路内いのレジンを一体に取り出す事が可能となるものである。

なお、このとき、各ゲート間にはレジン引込路 に連通した空気の遊げ道(エアーベント)が形成 されている。

以上、本発明者によってなされた発明を実施例にもとづき説明したが、本発明は上記実施例に限定されるものではなくその要旨を逸脱しない範囲で種々変更可能であることはいうまでもない。たとえば、レジン引込路は直線状でなく曲線状であっても良い。

以上の説明では主として本発明者によってなされた発明をその背景となった利用分野である半導体装置のモールド技術に適用した場合について説明したが、それに限定されるものではなく、たと

えば、1 ポット型のモールド装置にも適用することができる。

#### (発明の効果)

本願において開示される発明のうち代表的なものによって得られる効果を簡単に説明すれば下記のとおりである。

すなわち、キャビティ内にレジンが注入される 直前に位置するゲートにレジン引込路を設け、ゲ ート側面に沿って流動している空気を含んでいる レジンをレジン引込路中に取り込みポイドのない モールド製品を得ることができるものである。

### 4. 図面の簡単な説明

第1回は、本発明の一実施例であるマルチプラ ンジャ方式のモールド装置の下型平面図、

第2回は、第1回のモールド装置におけるレジン

ナス状態回。

第3回、第4回はそれぞれ第2回の『- 『線及び□- 『線断面図、

第5回は、第1回のモールド装置の IV → IV 線に おける断面説明図、 第6回は、従来のモールド装置の下型平面図、 第7回は、第6回のモールド装置に折れるレジ ン注入状態図、

第8回、第9回はそれぞれ第7回のⅣ—Ⅳ線及 びV— V線断面図である。

2 …カル、3 …ゲート、4 …構、10 …下型、 11 …ポット、12 …レジン引込路、13 …タブ レット状レジン、14 …プランジャ、15 …空気。

代理人 弁理士 小川 勝



# 第 1 図











